平成24年11月8日

各 位

上場会社名　株式会社 サンエー化研
代表者　代表取締役社長 藤岡　宣隆
（コード番号　4234）
問合せ先責任者　取締役経営企画部長 藤岡　貞章
（TEL　03-3241-5702）

業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成24年８月10日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

● 業績予想の修正について

平成25年3月期第2四半期（累計）連結業績予想数値の修正（平成24年4月1日～平成24年9月30日）

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	16,000	270	340	204	18.59
今回修正予想(B)	16,070	375	459	234	21.34
増減額(B-A)	70	105	119	30	
増減率(%)	0.4	39.2	35.0	14.8	
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成24年3月期第2四半期)	16,614	221	261	138	12.62

平成25年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	33,900	460	530	318	28.98
今回修正予想(B)	32,300	650	770	405	36.91
増減額(B-A)	△1,600	190	240	87	
増減率(%)	△4.7	41.3	45.3	27.4	
(ご参考)前期実績 (平成24年3月期)	32,095	143	259	△323	△29.44

平成25年3月期第2四半期（累計）個別業績予想数値の修正（平成24年4月1日～平成24年9月30日）

	売上高	経常利益	四半期純利益	1株当たり四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	14,400	340	204	18.59
今回修正予想(B)	14,626	457	239	21.87
増減額(B-A)	226	117	35	
増減率(%)	1.6	34.7	17.6	
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成24年3月期第2四半期)	15,119	202	115	10.50

平成25年3月期通期個別業績予想数値の修正（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	30,800	500	300	27.34
今回修正予想(B)	29,300	750	393	35.81
増減額(B-A)	△1,500	250	93	
増減率(%)	△4.9	50.0	31.0	
(ご参考)前期実績 (平成24年3月期)	29,133	201	△346	△31.57

修正の理由

長引く欧州の景気低迷と中国及び新興国の景気減速の影響を受け、軽包装材料と産業資材につきましては売上高が減少しましたが、機能性材料につきましては、スマートフォンやタブレット端末向けの表面保護フィルムが好調であったことから、他のセグメントの減収分を上回る増収を得ることができました。さらに当セグメントにおいては、設備稼働率の上昇に加えて製品の原価構成を見直したことから採算性が改善され、収益が向上いたしました。

その結果、当第2四半期累計期間の営業利益、経常利益はともに増加することとなりました。ただし、札幌工場跡地における土壌及び地下水汚染の対策費用のうち、汚染地下水の拡散防止対策に係る費用につきましては、工事内容が決定したことから、その見積額を特別損失に計上いたしましたので、四半期純利益の増加額はその分圧縮されました。

通期の業績予想につきましては、直近の経済環境や販売状況をもとに再度算定しましたところ、売上高は減少するものの、売上構成の変化と収益性改善効果により、営業利益、経常利益、当期純利益はいずれも増加する見込みとなりました。ただし、札幌工場跡地の汚染土壌の恒久的な浄化処理に係る費用につきましては、現時点で適切かつ妥当な工法が特定されておらず、当該費用を合理的に見積もることができないことから、当第2四半期累計期間ならびに通期の業績予想のいずれにも含めておりません。今後の調査によって、業績への影響が明らかになり、業績予想に関して修正の必要が生じた場合には、速やかに開示いたします。

（注）本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づくものであり、当社としてその達成を約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。

以　上